

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 19 年 11 月 15 日 (2007.11.15)

【公開番号】特開 2005-150097(P2005-150097A)

【公開日】平成 17 年 6 月 9 日 (2005.6.9)

【年通号数】公開・登録公報 2005-022

【出願番号】特願 2004-299587(P2004-299587)

【国際特許分類】

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

H 0 5 B 33/28 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 33/22 C

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 B 33/28

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 9 月 28 日 (2007.9.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】発光装置

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

絶縁膜に接するように形成された陽極と、
 前記陽極上に形成された電界発光層と、
 前記電界発光層上に形成された陰極とを有し、
 前記絶縁膜は、窒素及び珪素を含んでおり、
 前記陽極は、前記絶縁膜に接する透光性酸化物導電層と、前記電界発光層に接するバリア層とを有し、
 前記透光性酸化物導電層及び前記バリア層は、透光性酸化物導電材料及び酸化珪素を含んでおり、
 前記珪素の濃度は、前記透光性酸化物導電層よりも前記バリア層の方が高いことを特徴とする発光装置。

【請求項 2】

第 1 の絶縁膜と、
 前記第 1 の絶縁膜上に形成された第 2 の絶縁膜と、
 前記第 2 の絶縁膜に接するように形成された陽極と、
 前記陽極上に形成された電界発光層と、
 前記電界発光層上に形成された陰極とを有し、
 前記第 1 の絶縁膜は、シロキサン系材料を用いて形成されているか、またはアクリルを

用いて形成されており、

前記第2の絶縁膜は、窒素及び珪素を含んでおり、

前記陽極は、前記絶縁膜に接する透光性酸化物導電層と、前記電界発光層に接するバリア層とを有し、

前記透光性酸化物導電層及び前記バリア層は、透光性酸化物導電材料及び酸化珪素を含んでおり、

前記珪素の濃度は、前記透光性酸化物導電層よりも前記バリア層の方が高いことを特徴とする発光装置。

【請求項3】

請求項1または請求項2において、前記透光性酸化物導電材料は、ガリウムが添加された酸化亜鉛、酸化インジウムスズ、酸化亜鉛または酸化インジウム亜鉛であることを特徴とする発光装置。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか一において、前記バリア層は、前記電界発光層に含まれる正孔注入層または正孔輸送層と接していることを特徴とする発光装置。

【請求項5】

請求項1乃至請求項4のいずれか一において、前記発光装置はセミアモルファス半導体を用いたTFTを有していることを特徴とする発光装置。

【請求項6】

請求項1乃至5のいずれか一において、前記発光装置を有することを特徴とする電子機器。

【請求項7】

請求項6において、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ、ナビゲーションシステム、音響再生装置、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末、または記録媒体を備えた画像再生装置であることを特徴とする電子機器。